PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **94396228** A

(43) Date of publication of application: 29.10.92

(51) Int. CI

C08G 65/20

(21) Application number: 83871882

(22) Date of filing: 04.04.91

(71) Applicant:

DAICEL CHEM IND LTD

(72) Inventor:

YOKOTA SHIGERU MORI MISAO TAGAWA KUNIO

(54) PRODUCTION OF POLYOXYTETRAMETHYLENE GLYCOL

(57) Abstract:

PURPOSE: To produce polyoxytetramethylene glycol from tetrahydrofuran using a solid acid catalyst capable of simply carrying out recovery and recycle and readily regenerating as a polymerization datalyst.

CONSTITUTION: Production of polyoxytetramethylene glycol comprising polymerizing tetrahydrofuran in the

presence of a solid solid catalyst consisting of a complex metal oxide selected from a group of a metal axide expressed by the general formula M_xO_y (X and Y are integer of 1 or 3) and carboxylic acid anhydride. It to efficiently produce reade eldisaag polyoxytetramethylene glycol in high yield by using the solid acid catalyst capable of simply carrying out recovery and recycle and more readily regenerating as the polymerization catalyst.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

(19) E 本図物新庁 (J P) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平4-306228

(43)公開日 平成4年(1992)10月29日

(SI) Int.CL⁵

FI

技術表示簡所

C 0 8 G 65/20

NQE 9167-4J

審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)

(21)出類番号

特職平3~71882

(22)出額日

平成3年(1991)4月4日

(71)出願人 000002901

ダイセル化学工業株式会社

大阪府堺市鉄砲町1番地

(72) 発明者 横田 滋

広島県大竹市玖波4丁目13-5

(72)発明者 森 三佐雄

広島県大竹市玖波6丁目8-5

(72)発明者 田川 邦雄

山口県玖珂郡和木町関ケ浜1-3-1

(54) 【発明の名称】 ポリオキシテトラメチレングリコールの製造方法

(57) [要約]

【目的】本発明の目的は、国収・リサイクルの簡単で、 **触媒再生の容易な資体酸触媒を使って、THFよりPT** MGを製造する方法を開発することにある。

[構成] 一般式: M. O. (X、Yは1ないし3の整 数)で示される金属酸化物の群から選ばれる複合金属酸 化物から成る関体酸触媒とカルボン酸無水物の存在下、 テトラヒドロフランを重合させることを特徴とするポリ オキシテトラメチレングリコールの製造方法。

【剱果】本発明の方法により、回収・リサイクルの簡単 で、かつ従来より触媒再生の容易な間体酸触媒を薫合触 媒として使用することにより、高収率で効率良くポリオ キシテトラメチレングリコールを製造することが可能に なった。

【特許請求の範囲】

【謝求項1】 一般式: M。O。 (X、Yは1ないし3 の整数) で示される金属酸化物の群から選ばれる複合金 展盤化物からなる団体酸触媒とカルボン酸無水物の存在 下、テトラヒドロフランを薫合させることを特徴とする ボリオキシテトラメチレングリコールの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はテトラヒドロフラン(以 下、THFと略す)を固体酸触媒を重合触媒として用い 10 **重合させ、高収率でポリオキシテトラメチレングリコー** ル(以下、PTMGと略す)を製造する方法に関する。 [00002]

【従来の技術】PTMGは、スパンデックス。エラスト マー、人口皮革等に用いられるポリウレタン、ポリエー テルエステル、ボリエーテル(エステル)アミドの主願 料や界面活性剤、圧力液体等に用いられる工業的に有用 なポリマーであり、近年ではエラストマー分野を中心に エンジニアリング用素材。医用高分子材料として特に往 胃を浴びている。

【0003】PTMGはTHFの重合によって工業的に 製造されでいるが、この重合反応はカチオン重合であ り、しかも容易には進行しないためにその重合触媒とし ては、超強腱として分類される酸強度の大きいプロトン 酸やルイス酸が使われ、かつしばしばこれらに共触媒を 加えたものが使用されてきている。

【0004】前者の代表例は、フルオロスルホン酸、発 煙硫酸であり、後者の例としては、過塩素酸ー無水酢 酸、BF。一HF一無水酢酸、ナフイオン(弗素化スル れ、これらの重合直後の末端基は一5〇。日基、或いは -OCOCH。基として停止されており、これに水或い はアルカリ水を加えて過水分解するか、もしくはアルコ ール分解し、脚末端を水酸基とする二段法によってい ٥.,

【0005】これらは、工業的に実施されているが、廃 水に対するCOD負荷が大きい、触媒寿命が短い、触媒 の再生が困難である等の問題がある。

【0006】発煙硫酸を触媒として用いる重合方法も知 られているが、分子盤1000前後に限定される用途に 40 は用いられるが、この後処理で水を加えねばならず。触 媒のリサイクル利用は極めて困難である(特公昭52-32680%).

【0007】また、共触媒等を使用せずにTHFを重合 させ、且つ一挙に末端〇日基を有するPTMGとする方 法として、ヘテロボリ酸触媒や固体超強離を用いる方法 も知られている。しかしながら、前者は高価なヘテロボ リ酸触媒を高濃度で使用しているため、触媒回収に神経 を払わなくてはならず、さらにはヘテロポリ酸触媒がT HFに僅かに溶解するため、PTMG製品化時に、微量 50

のヘテロボリ酸触媒をPTMGと分離するために、一段 法であるにもかかわらず、プロセスが複雑になっていた (特公昭63-30931)。

【0008】また、後者も高価な五弗化アンチモンを触 媒として用いており、触媒回収に神経を払わなくてはな らなく、また担持した五弗化アンチモンが脱離してくる ため、工業的に実施するのが難しくなっている(特開昭 63 - 35623).

[0009]

【発明が解決しようとする課題】これら従来技術は、触 媒回収が出来なく、廃水負荷が大きいケースや、触媒回 収が可能な場合でも、原料THFに対して触媒が若干溶 解するために触媒回収プロセスが複雑になるケース、触 媒回収しても触媒再生が非常に困難なケースが多い。

[0010]

【発明の目的】本発明の目的は、国収・リサイクルの簡 単で、触媒再生の容易な磁体酸触媒を使って、THFよ りPTMGを製造する方法を開発することにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】すなわち、一般式:M. Oy (X、Yは1ないし3の整数)で示される金属酸化 物の群から選ばれる複合金属酸化物からなる固体酸触媒 と少なくとも1種のカルボン酸または/及びカルボン酸 無水物の存在下、テトラヒドロフランを薫合させること を特徴とするポリオキシテトラメチレングリコールの製 造方法である。本発明で触媒として使用する複合金属酸 化物は、酸化アルミニウム(A La Oa)、二酸化ケイ 素(SiOx)、二酸化チタン(TiOx)、二酸化ジ ルコニウム(ZrOs)、三酸化タングステン(W ホン酸樹脂)- 無水酢酸、活性白土-無水酢酸が挙げら 30 〇。)、酸化亜鉛(2 n 〇)等から選ばれる成分を組み 合わせた系で、例えばAl。Os - SiOs 、SiOs -TiOz, SiOz -ZrOz, TiOz -ZrOz 等がある。

> 【0012】これらの複合金属酸化物は、それぞれの金 属のアルコキシド、塩化物、またはオキシ塩化物をアン モニア水で複合金属酸化物として沈澱させ、この沈澱を 十分、洗浄、約100℃で乾燥、粉砕(200~500 メッシュ)後、300℃ないし800℃、好ましくは4 50℃ないし500℃で焼成して得られる。

> 【0013】金属のモル組成は1:9ないし9:1の範 囲であるが、モル組成の調整は用いる金属アルコキシ ド、塩化物またはオキシ塩化物中の金属組成より決めら れる。金属アルコキシドとしては、テトラエチルオルト シリケート(S I (O C。H。)。)、アルミニウムイ ソプロポキシド(A I 〔O CH(CHa)a)a)等。 塩化物としては四塩化チタン(TiCl。)、塩化亜鉛 (ZnCl) 等。またオキシ塩化物としてはオキシ塩 化ジルコニウム (ZrOCl: ・8H: O) 等を挙げる ことができる。

- 【0014】また、調製した固体酸触媒は単合反応の開

始前に再度400℃ないし600℃、好ましくは450 **むないし500℃で焼成して用いる。**

【0015】本発明に使用する固体酸触媒の使用量は目 的とする重合条件、PTMGの分子量、併用するカルボ ン酸無水物によって異なるが、反応組被中における固体 酸触媒機度としては、0.1~50wt%、より好まし くは1~30wt%程度で使用される。

【0016】本発明において使用するカルボン酸無水物 としては、好ましくは脂肪族又は芳香族の2~12個特 に2~8幅の炭素原子を有するボリー及び/又は特にモ 10 ノカルボン酸から誘導されるものが用いられる。

【0017】例えば、脂肪族カルボン酸の無水物では、 紙水酢酸、無水酪酸、無水プロビオン酸、無水バレリア ン酸、無水カプロン酸、無水カブリル酸、無水ペラルゴ ン酸等、芳香族カルボン酸の無水物では、無水フタル 酸、無水ナフタリン酸等、脂肪族ポリカルボン酸の無水 物では、無水こはく酸、無水マレイン酸等が挙げられ る。 これらのカルボン酸無水物の内で、価格及び入手 の容易さから考えると、無水酢酸がより好ましい。

【0018】本発明に使用するカルボン酸無水物の使用 20 きない。 盤は目的とする無合条件、PTMGの分子盤、関体酸酸 媒の使用量によって異なるが、反応粗液中におけるカル ポン酸無水物濃度としては、0.3~30wt%、より 好ましくは1~20wt%程度で使用される。

[0019] 第合温度は-20℃-150℃の範囲であ るが、より好ましくは0℃~100℃程度でよい。

【0020】至合反応は触媒添加後、1~15時間、通 常3~10時間実施される。

【0021】ここで云う薫合反応時間とは、バッチ方式 においては、反応温度まで温度が上昇した時点から反応 30 が終了して冷却を開始するまでの時間のことを示し、運 統方式においては、反応器中での反応程波の滞留時間の ことを示している。

【0022】反応形式は、機型、塔型等。一般に用いら れるものが使用される。バッチ方式。連続方式のいずれ の方法で行っても良い。

[0023] 具体的には、THFと固体酸触媒を反応器 に張り込んで、攪绊下カルボン酸無水物を連続的に反応 器に仕込んで、薫合させる方法(パッチ方式)、TH F、関体整触媒及びカルボン酸無水物を適当な滞留時間 40 ステル価により求めた。 となるように、連続的に反応器へ仕込んで、連続的に固 体酸触媒含みの反応組被を抜き取って行く方法または、 固体酸触媒を反応器内に封じ込めておき、THFとカル ボン酸無水物を適当な滞留時間となるように、連続的に 反応器へ仕込んで、連続的に反応粗液を抜き取って行く 方法(連続方式)のいずれかの方法で行われる。

【0024】反応方式の選択は、PTMG製造量、単台 熱の除熱量、触媒の性状等を考慮して決定すべきである が、個体酸触媒を反応器内に封じ込めておく固定床方式 が触媒分離工程が省けるのでより好ましい。

【0025】 重合反応は通常、設備費等の問題から常圧 で行われ、加圧で反応を行っても、ほとんどメリットは ないが、高沸点の反応に不活性な溶媒を用いずに、TH

Fの沸点以上で反応を行う場合などは加圧で反応を行っ ても良い。

[0026] 重合反応には、溶媒を用いると重合反応後 に溶媒の回収工程が新たに必要となるので、通常溶媒は 用いないが、高い重合温度で反応を行いたい時などは高 沸点の反応に不活性な溶媒を用いても構わない。

【0027】上記方法によって得られる触媒懸濁重合策 から固体酸触媒は濾過または遠心分離で除去され、回収 された触媒はそのまま再使用されるか、もし繰り返し再 使用して重合活性が低下するようなら、THFで洗浄、 乾燥後、空気中400~700℃で焼成して、再使用す ると元の活性が回復する。

【0028】従来の技術の中にも固体酸触媒として漂白 土を使っているものもあるが、重合活性が低下しても触 媒の耐熱温度が低いため、上記のような空気中400~ 700℃での焼成ができないだけでなく、触媒再生がで

【0029】触媒分離後の反応粗液から未反応のTH F、カルボン酸無水物を留去すればポリオキシテトラメ チレングリコールシアセテートが得られるが、最終的に PTMGを製造するには以下のように行うのが好まし

[0030] アルカリ水を加えることにより未端エステ ル基を加水分解して、末端を水酸基に変え、適当な有機 溶媒、例えばベンゼン、トルエン、キシレン、nープタ ノール、ジーイソプロビルエーテル等の存在下に精製、 密媒回収、脱水を実施しても良いし、アルコールとエス テル交換して(米国特許第2499725号及びジャー ナル・オブ・アメリカン・ケミカル・ソサイエデイ70 巻1842ページ参照)、対応するPTMGに変える。

【0031】以下、実施例及び比較例を挙げて本発明を 説明するが、本発明はこれらの実施例及び比較例によっ て何ら制限されるものではない。

【0032】以下の実施例及び比較例において、数平均 分子機MNはJIS K0070-1966に準拠した ボリオキシテトラメチレングリコールジアセテートのエ

[0033]

【実施例1】機幹装置、還流冷却器及び無水酢酸仕込み ボンプを備えた容量300ミリリットルのジャケット付 きガラス製フラスコにTHF150gと空気中500℃ で4時間焼成した日揮化学(株)N633Lシリカーア ルミナ触媒粉末15、0gを張り込み、40℃機絆下 に、無水酢酸8。28gを約15分で住込み、4時間重 合反応を行った。

【0034】重合反応後、反応粗液を濾過して触媒分離 50 し、濾液から未反応のTHF及び無水酢酸を留去、減圧 \tilde{s}

乾燥し、82、0gのポリオキシテトラメチレングリコ ールジアセテートを得た。エステル価より求めたポリオ キシテトラメチレングリコールジアセテートの数平均分 子量は1220であった。

[0035]

【実施例 2】 幾拌装置、還流冷却器及び無水酢酸仕込み ボンプを備えた容量300ミリリットルのジャケット付 きガラス製フラスコにTHF150 xと空気中500℃ で4時間焼成した日揮化学(株)N633Lシリカーア に、無水酢酸8、28gを約15分で住込み、4時間重 合反応を行った。

【0036】重合反応後、反応組液を濾過して触媒分離 し、濾液から未反応のTHF及び無水酢酸を留去、減圧 乾燥し、48、3gのポリオキシテトラメテレングリコ ールジアセテートを得た。エステル価より求めたポリオ キシテトラメチレングリコールジアセテートの数平均分 子量は1830であった。

[0037]

ボンプを備えた容量300ミリリットルのジャケット付 きガラス製フラスコにTHF150gと空気中500℃ で4時間焼成した日揮化学(株)N633Lシリカーア ルミナ触媒粉末15、0gを張り込み、60℃攪拌下 に、無水酢酸8.28gを約15分で仕込み、4時間重 合反応を行った。

【0038】重合反応後、反応組液を濾過して触媒分離 し、濾液から未反応のTHF及び無水酢酸を留去。減圧 乾燥し、50、6gのポリオキシテトラメチレングリコ ールジアセテートを得た。

【0039】エステル価より求めたポリオキシテトラメ チレングリコールジアセテートの数平均分子量は820 であった。

[0040]

【実施例 4】 機件装置、凝流冷却器及び無水酢酸仕込み ボンプを備えた容量300ミリリットルのジャケット付 きガラス製フラスコにTHF150gと空気中500℃ で4時間焼成した日輝化学(株) N633Lシリカーア ルミナ繁蝶粉末15、0gを張り込み、40℃攪絆下 に、無水酢酸 4、14gを約8分で仕込み、4時間重合 40 【0048】 反応を行った。

【0041】重合反応後、反応粗液を濾過して触媒分離 し、鎌波から未反応のTHF及び無水酢酸を留去、減圧 乾燥し、64、0gのポリオキシテトラメチレングリコ ールジアセテートを得た。エステル価より求めたポリオ キシテトラメチレングリコールジアセテートの数平均分 子園は1760であった。

[0 0 4 2]

【実施例5】機件装置、運流冷却器及び無水酢酸仕込み ボンブを備えた容盤300ミリリットルのジャケット付 80 メチレングリコールジアセテートを得た。

きガラス製フラスコにTHF150gと空気中500℃ で4時間焼成した日揮化学(株)N633Lシリカーア ルミナ触媒粉末15、0gを張り込み、40℃攪拌下 に、無水酢酸16.56gを約30分で仕込み、4時間 重合反応を行った。

[0043] 重合反応後、反応組液を譲過して触媒分離 し、確核から未反応のTHF及び無水酢酸を留去、減圧 乾燥し、98、8gのポリオキシテトラメデレングリコ ールジアセテートを得た。エステル個より求めたポリオ ルミナ触線粉末15.0gを張り込み、20℃機摔下 10 キシテトラメチレングリコールジアセテートの数平均分 子量は820であった。

[0044]

【実施例6】 攪拌装置、還流冷却器及び無水酢酸仕込み ポンプを備えた容量300ミリリットルのジャケット付 きガラス製フラスコにTHF150gと空気中500℃ で4時間焼成した日揮化学(株)N633HNシリカー アルミナ触媒粉末15、0gを張り込み、40℃攪絆下 に、無水酢酸8.28gを約15分で仕込み、4時期重 合反応を行った。

【宰旅銅3】 撥枠装置、資施冷却器及び無水酢酸仕込み 20 【0045】 重合反応後、反応粗液を濾過して触媒分離 し、被被から未反応のTHF及び無水酢酸を留去。減圧 乾燥し、73、1gのポリオキシテトラメチレングリコ ールジアセテートを得た。エステル価より求めたポリオ キシテトラメチレングリコールジアセテートの数平均分 子量は1160であった。

[0046]

【実施例7】攪拌装置、還流冷却器及び無水酢酸住込み ボンプを備えた容盤300ミリリットルのジャケット付 きガラス製フラスコにTHF150gと空気中500℃ 30 で4時間焼成した日揮化学(株) N633HNシリカー アルミナ触媒粉末15.0gを張り込み、40℃機拌下 に、無水酢酸8、28gを約15分で仕込み、4時間重 合反応を行った。

【0047】重合反応後、反応組被を濾過して触媒分離 し、濾液から未反応のTHF及び無水酢酸を留去、減圧 乾燥し、73、1gのポリオキシテトラメチレングリコ ールジアセテートを得た。エステル価より求めたポリオ キシテトラメチレングリコールジアセテートの数平均分 子景は1160であった。

【実施例8】反応器出口に冷却器を備えた内径30mm 長さ200mmのピストンプロー型ジャケット付反応器 に空気中500℃で4時間焼成したシリカーアルミナ (アルミナイ0%) 触媒打錠品を100ミリリットル充 填し、反応温度40℃下に、無水酢酸3.8w±%含有 のTHF溶液を20ミリリットル/hの仕込み速度で選 続的に反応器に132時間の連続運転を行った。

【0049】反応粗液から未反応のTHF及び無水酢酸 を留去。滅圧乾燥し、404、3gのポリオキシテトラ

7

【0050】エステル鉱より求めたポリオキシテトラメチレングリコールジアセテートの数平均分子盤は102 0であった。

[0051]

【比較例1】実施例8の反応成績は、反応開始から36時間目のSTY38、8kg/m³/hrから132時間目のSTY20、4kg/m³/hrへと触媒活性は徐々に低下している。

【0052】したがって、触媒の使用率を下げるためにも、触媒再生を行って再使用するのが好ましい。そこで、実施例8で使用していた触媒をTHFで洗浄・乾燥後、内径30mm長さ400mmの石英ガラス製反応器に充填し、空気を100ミリリットル/minの速度で流しなが5500でで7時間焼成した。

【0053】焼成した触媒を使用して実施例8と同様の操作を行ったところ、406、2gのポリオキシテトラメチレングリコールジアセテートを得た。

【0054】エステル価より求めたポリオキシテトラメチレングリコールジアセテートの数平均分子量は106 0であった。

【0055】比較例1は本発明の触媒活性が低下して も、空気雰囲気下の焼成処理によって、簡単にその活性

が回復することを示している。 【0056】

【実施例9】反応器出口に希却器を備えた内径30mm 長さ200mmのピストンフロー型ジャケット付反応器 に空気中500℃で4時間焼成した日押化学(株)シリ カーアルミナ(631L)触媒打錠品を100ミリリットル充填し、反応温度40℃下に、無水酢酸3.8wt %含有のTHF溶液を20ミリリットル/トの仕込み速 度で連続的に反応器に130時間の連続運転を行った。

も、触媒再生を行って再使用するのが好ましい。そこ 10 【0057】反応粗液から未反応のTHF及び無水酢酸で、実施例8で使用していた触媒をTHFで洗浄・乾燥 を留去、減圧乾燥し、571.2gのポリオキシテトラ後、内径30mm長さ400mmの石英ガラス製反応器 メチレングリコールジアセテートを得た。

【0058】エステル価より求めたポリオキシテトラメ チレングリコールジアセテートの数平均分子盤は125 0であった。

[0059]

【発明の効果】本発明の方法により、回収・リサイクル の簡単で、かつ従来より触媒再生の容易な固体酸触媒を 重合触媒として使用することにより、高収率で効率良く 20 ポリオキシテトラメチレングリコールを製造することが 可能になった。(以下余白)